

公益社団法人 化学工学会 反応工学部会 CVD 反応分科会主催

## 第 42 回シンポジウム

# 「半導体産業における洗浄・乾燥技術の最新動向」

共催 CVD 研究会, Cat-CVD 研究会

### 開催趣旨

半導体産業における洗浄・乾燥技術では、付着物やパーティクルの除去や水分・溶媒除去の役割に加え、ナノスケールの微細構造の倒壊を抑制する研究・技術開発が広く進められています。今回のシンポジウムでは、半導体産業における洗浄・乾燥プロセスの最新動向をご紹介頂き、今後の将来展望を含めた議論・意見交換を通して、洗浄・乾燥プロセス設計に対する理解を深める機会とすることを目的とします。

日時： 2025 年 8 月 29 日(金) 13:00～17:00

会場： Zoom によるオンラインリアルタイム配信

実施形態： オンライン

参加費(税込)： 化学工学会 CVD 反応分科会法人賛助会員 (無料),  
化学工学会 CVD 反応分科会個人会員 (2,000 円),  
化学工学会 反応工学部会会員 (3,000 円), 化学工学会会員 (4,000 円),  
CVD 研究会会員 (4,000 円), Cat-CVD 研究会会員 (4,000 円),  
非会員 (10,000 円), 学生 (無料)

申込方法： 次の Web サイトよりお申し込み下さい。また、[peatix.com](https://peatix.com) ドメインからのメールを受信可能としておいてください。

[https://\(準備中\)](https://(準備中))

アクセスできない場合には、(1)氏名、(2)所属、(3)連絡先 E-mail、(4)参加資格(所属学会等)、(5)参加形態(対面参加、オンライン参加)を明記のうえ、[cvd@scej.org](mailto:cvd@scej.org) までメールにてお申し込み下さい。

申込締切： 8 月 26 日(火)正午 厳守 (締め切り後の申し込みは一切できません。)

オンライン参加 300 名の定員に達し次第、申し込み受付を終了いたします。

問い合わせ先： CVD 反応分科会事務局 E-mail：[cvd@scej.org](mailto:cvd@scej.org)

### 注意事項

- ・参加費はクレジットカードにてお支払いください。
- ・参加者による録画・録音は一切禁止とします。
- ・会議 URL ならびに講演資料入手方法は参加申込者にのみ開催日前日にメールにてお送りします。
- ・懇親会は行いません。
- ・諸事情により、内容が変更される場合があります。
- ・講演動画の事後配信は致しません。

<講演プログラム>

- 12:45 Zoom 開場
- 13:00～13:05 開会の挨拶 東京科学大学 下山 裕介
- 13:05～13:45 半導体製造プロセスにおけるクリーン化技術  
オフィスシラミズ 白水 好美 氏
- 13:45～14:25 半導体ウェット洗浄におけるシミュレーション事例  
SCREEN セミコンダクターソリューションズ 佐藤 雅伸 氏
- 14:25～15:05 半導体ウェハーの洗浄および乾燥工程に関する熱流体工学解析  
群馬大学 天谷 賢児 氏
- 15:05～15:15 休憩
- 15:15～15:50 半導体の二流体スプレー洗浄時における静電気障害  
愛知工業大学 清家 善之 氏
- 15:50～16:30 超臨界乾燥技術  
株式会社レクザム 山内 守 氏
- 16:30～16:40 閉会の挨拶 CVD 反応分科会代表 京都大学 河瀬 元明

シンポジウムオーガナイザー

- 下山裕介 (東京科学大学)  
清水秀治 (太陽日酸株式会社)  
西田 哲 (岐阜大学)